



(21)申請案號：104214178

(22)申請日：中華民國 104 (2015) 年 09 月 01 日

(51)Int. Cl. : A61F5/14 (2006.01)

(71)申請人：葉雲繡(中華民國) (TW)

新竹市鐵道路 2 段 18 號

(72)新型創作人：葉雲繡 (TW)

(74)代理人：侯德銘

申請專利範圍項數：6 項 圖式數：7 共 15 頁

(54)名稱

矯正鞋墊

(57)摘要

一種矯正鞋墊，包括前足部、中足部與後足部，該中足部與後足部內外兩側位置分別具有不同隆起弧度的內側縱弓區與外側縱弓區，該鞋墊橫向具有一蹠骨線，該蹠骨線為行走時該鞋墊主要彎折線，該鞋墊中間具有一隆起的蹠骨橫弓區，該蹠骨線通過蹠骨橫弓區，本創作於該鞋墊於內、外側邊位置分別具有一矯正凸部，該矯正凸部的最高點位於該蹠骨線朝足根方向的 6~10mm 處，向上凸起的高度為 6~10mm，由該最高點是向鞋墊中央的延伸距離為 6~10mm，藉此能適用於矯正扁平足與姆指外翻的族群。

指定代表圖：

符號簡單說明：

1 . . . 前足部

2 . . . 中足部

3 . . . 後足部

4 . . . 蹠骨橫弓區

5 . . . 內側縱弓區

6 . . . 外側縱弓區

8 . . . 支撐部

9 . . . 矯正凸部

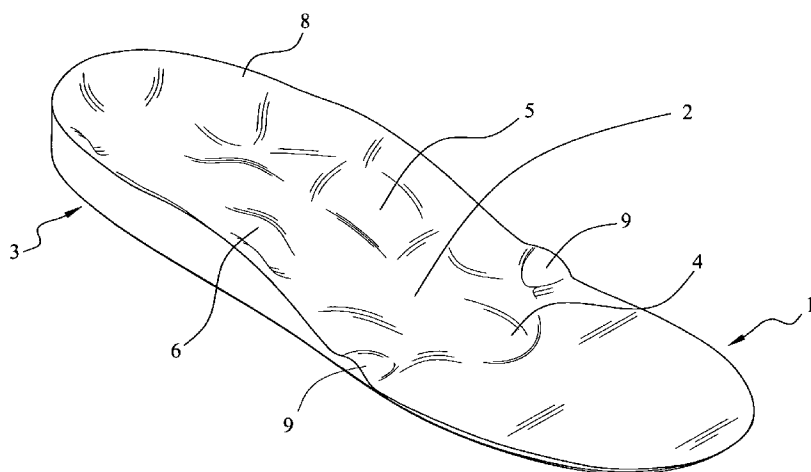


圖2

新型摘要

※ 申請案號：104214178

※ 申請日：104.9.01

※IPC 分類：A61F5/14 (2006.01)

【新型名稱】(中文/英文)

矯正鞋墊

【中文】

一種矯正鞋墊，包括前足部、中足部與後足部，該中足部與後足部內外兩側位置分別具有不同隆起弧度的內側縱弓區與外側縱弓區，該鞋墊橫向具有一蹠骨線，該蹠骨線為行走時該鞋墊主要彎折線，該鞋墊中間具有一隆起的蹠骨橫弓區，該蹠骨線通過蹠骨橫弓區，本創作於該鞋墊於內、外側邊位置分別具有一矯正凸部，該矯正凸部的最高點位於該蹠骨線朝足根方向的6~10mm處，向上凸起的高度為6~10mm，由該最高點是向鞋墊中央的延伸距離為6~10mm，藉此能適用於矯正扁平足與姆指外翻的族群。

【英文】

【代表圖】

【本案指定代表圖】：圖2。

【本代表圖之符號簡單說明】：

前足部	1
中足部	2
後足部	3
蹠骨橫弓區	4
內側縱弓區	5
外側縱弓區	6
支撐部	8
矯正凸部	9

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【新型名稱】(中文/英文)

矯正鞋墊

【技術領域】

【0001】 本創作為一種矯正鞋墊的技術領域，尤其指一種能針對腳姆指外翻及扁平足進行矯正的鞋墊。

【先前技術】

【0002】 如圖1所示，為一足部的動態行進線。正常人足弓內凹，行走略為外八，行走時由腳跟先著地，腳掌離開。分析腳掌骨骼在行走時重心所在處所呈現的動態行進線，正常人的動態行進線A1是由腳跟中央，沿腳掌中心點，在蹠骨關節處偏移(圖中線B為虛擬的蹠骨關節位置)，最後於大姆指及食指間。但若是為腳姆指外翻者，會使身體的重心由腳掌中心點向內偏移，而扁平足者，因內側足弓塌陷，也會使身體重心由腳掌中心點向內偏移，此兩者的動態行進線A2是由腳跟中央，沿腳掌中心點，在蹠骨關節處大幅偏移，最後經大姆指外側，此狀態會使腳掌骨骼處不正常位置，長時間行走容易產生疼痛或病變，因此必須利用一矯正鞋墊來支撐腳掌，改變行走時腳掌骨骼的分佈狀態，減少不舒適感，引導回正確的動態行進線。

【新型內容】

【0003】 本創作之主要目的係提供一種矯正鞋墊，用以使腳底獲得良好舒適的支撐，矯正足部站立的姿態，調整站立時腳掌蹠骨及趾骨的位置，

針對腳姆指外翻或扁平足等狀況獲得正確良好的矯正。

● **【0004】** 為達上述之目的，本創作矯正鞋墊包括前足部、中足部與後足部，該中足部與後足部內外兩側位置分別具有隆起的內側縱弓區與外側縱弓區，該鞋墊橫向具有一蹠骨線，該蹠骨線為行走時該鞋墊主要彎折線，該鞋墊具有一隆起的蹠骨橫弓區，該蹠骨線通過該蹠骨橫弓區，其特徵在於：該鞋墊於內、外側邊位置分別具有一矯正凸部，該矯正凸部的最高點位於該蹠骨線朝足根方向的6~10mm處，向上凸起的高度為6~10mm，由該最高點是向鞋墊中央的延伸距離為6~10mm。此設計能矯正腳姆指外翻的族群。

【0005】 再者為了針對扁平足患者，本創作將是該前足部鞋墊的厚度是由內側邊緣漸漸向外側邊緣遞減，該前足部鞋墊頂面呈一斜面狀，為內側高、外側低的傾斜結構，改變扁平足原本重心於腳掌中心點偏向內側的情形，引導重心恢復腳掌中心點位置，進一步解決扁平足所遭受到的問題。

【0006】 以下配合圖式及元件符號對本創作之實施方式做更詳細的說明，俾使熟習該項技藝者在研讀本說明書後能據以實施。

● **【圖式簡單說明】**

【0007】

圖1為足部的動態行進線；

圖2為本創作之立體圖；

圖3為本創作之俯視圖；

圖4A為圖3之AA剖面圖；

圖4B為圖3之BB剖面圖；

圖5為本創作之鞋墊底部之示意圖；

圖6為本創作之另一實施例的示意圖；

圖7為姆指外翻者之腳底骨骼的示意圖。

【實施方式】

● **【0008】** 本創作為一種矯正鞋墊能針對腳姆指外翻及扁平足者，給予腳掌骨骼適當的支撐，回歸至正常人腳掌由內側縱弓、外側縱弓、蹠骨橫弓和足跟得均勻支撐，分散腳的力量，並訓練肌肉，讓姿勢和習慣回到正確的位置，進而整直身體脊椎及骨骼支架，為一種支撐、矯正足部及姿勢變形所用的醫療器材。

● **【0009】** 如圖2及圖3所示，分別為本創作之立體圖及俯視圖，本創作鞋墊是由乳膠或凝膠或矽膠一體成型製成，包括前足部1、中足部2與後足部3。該前足部1的底部為平坦狀，整體厚度大致相同。該鞋墊在不同位置分別具有向上凸起的蹠骨橫弓區4、內側縱弓區5與外側縱弓區6。該鞋墊具有一蹠骨線7，圖3中以假想線表示，實際鞋墊上並未畫出此線，該蹠骨線7是行走時該鞋墊主要彎折區域，相對於腳掌的數蹠骨與數趾骨相接位置。該蹠骨橫弓區4位於該鞋墊中央位置，呈向上圓弧狀凸起，該蹠骨線7通過該蹠骨橫弓區4。該內側縱弓區5與外側縱弓區6分別延伸分佈於該中足部2與該後足部3的內側及外側。如圖4A所示，該內側縱弓區5向上隆起的弧度不同於該外側縱弓區6，兩者所在位置並不在同一橫向位置。該內側縱弓區5靠近蹠骨線方向，凸出弧度較大，可以貼合於腳掌內側之縱向足弓處。另外該後足部3周圍具有呈U型環繞且內緣呈弧形的支撐部8，該支撐部8有助於將腳跟周邊的脂肪集中於跟腳底面，緩衝行走時腳跟承受的重量。

【0010】 如圖5所示，該中足部2底部另具有數凹槽21，部份凹槽的形

狀並不同相同，在本實施例中為兩排三角形槽及中間位置另具有一圓形槽，如此使鞋墊具有良好的緩衝效果。

● **【0011】** 本創作鞋墊針對腳姆指外翻的情形另設計一特殊的結構，如圖2、圖3及圖4B所示，主要是於該鞋墊於內、外側邊位置分別具有一矯正凸部9，該矯正凸部9最高點位於該蹠骨線7朝足根方向距離L1的位置，該距離L1為6~10mm，向上凸起的高度H為6~10mm，該矯正凸部9由最高點向鞋墊中央延伸距離L2為6~10mm。該矯正凸部9呈圓弧狀凸起，以減少足部的不適，所在位置相對於該腳掌兩側蹠骨位置，主要是利用該矯正凸部9施壓於蹠骨處，牽引著該趾骨返回原來的位置。

● **【0012】** 如圖6所示，為本創作第二實施例圖。在本實施例中，進一步針對扁平足進一步提供不同的設計，主要是於改變該前足部1的厚度，該厚度是由該前足部1的內側邊緣漸漸向外側邊緣遞減(圖中由左邊向右邊)，呈一斜面狀，即該前足部1的頂面內側位置高於外側，傾斜狀態是由該前足部1的足尖至與中足部2相接處皆採相同方式分佈。此設計輔助矯正扁平足正確引導後跟骨回復至正確的位置。

【0013】 綜合以上所述，本創作矯正鞋墊安裝於鞋子內，利用向上凸起的蹠骨橫弓區4、內側縱弓區5與外側縱弓區6等，將腳掌骨骼恢復至正確的位置，使足骨關節與足底的韌帶和肌腱等共同構成一個具有彈性的拱形橋樣的弓形結構，這個結構的組合體可把直立時的體重平均分佈於足跟與蹠骨頭之間，在行走、跑、跳運動和負重時，足弓可稍退讓而吸收震盪，且兩足各全面著地而保持身體的穩定與平衡。再者，如圖7，針對腳姆指外翻者，利用兩個該矯正凸部9分別施壓於內、外側不同位置的蹠骨，改變蹠

骨與趾骨關節位置，進而牽引著該趾骨由原本外翻狀態恢復為正常位置。而針對扁平足者，因無足弓，重心由腳掌中心點向內偏移，本創作是將該前足部1設計為內側高、外側低的傾斜結構，引導重心恢復至正常位置，亦能有效改善扁平足無法久站、跑步、走遠路的問題。

【0014】 以上所述者，僅為本創作之較佳實施例而已，並非用來限定本創作實施例之範圍。即凡依本創作申請專利範圍所作的均等變化及修飾，皆為本創作之專利範圍所涵蓋。

● **【符號說明】**

【0015】

前足部	1
中足部	2
後足部	3
蹠骨橫弓區	4
內側縱弓區	5
外側縱弓區	6
● 蹠骨線	7
支撐部	8
矯正凸部	9
動態行進線	A1
動態行進線	A2
線	B
距離	L1
距離	L2
高度	H

申請專利範圍

- 1.一種矯正鞋墊，該鞋墊包括前足部、中足部與後足部，該中足部與該後足部內外兩側邊位置分別具有隆起弧度的內側縱弓區與外側縱弓區，該鞋墊橫向具有一蹠骨線，該蹠骨線為行走時該鞋墊主要彎折位置，該鞋墊具有一隆起的蹠骨橫弓區，該蹠骨線通過該蹠骨橫弓區，其特徵在於：該鞋墊於內、外側邊位置分別具有一矯正凸部，該矯正凸部的最高點位於該蹠骨線朝足根方向的 6~10mm 處，向上凸起的高度為 6~10mm，由該最高點是向鞋墊中央的延伸距離為 6~10mm。
- 2.如申請專利範圍第 1 項所述的矯正鞋墊，其中該內側縱弓區隆起的最高位置高於該外側縱弓區隆起的最高位置，兩個最高位置距足跟的距離並不相同。
- 3.如申請專利範圍第 1 項所述的矯正鞋墊，其中該後足部周圍具有呈 U 型環繞且內緣呈弧形的支撐部。
- 4.如申請專利範圍第 1 項所述的矯正鞋墊，其中該前足部的厚度大部份皆相同，適用腳姆指外翻者。
- 5.如申請專利範圍第 1 項所述的矯正鞋墊，其中該前足部的厚度是由內側邊緣漸漸向外側邊緣遞減，該前足部頂面呈一斜面狀，適用於扁平足者。
- 6.如申請專利範圍第 1 項所述的矯正鞋墊，其中該鞋墊底部具有數凹槽。

圖式

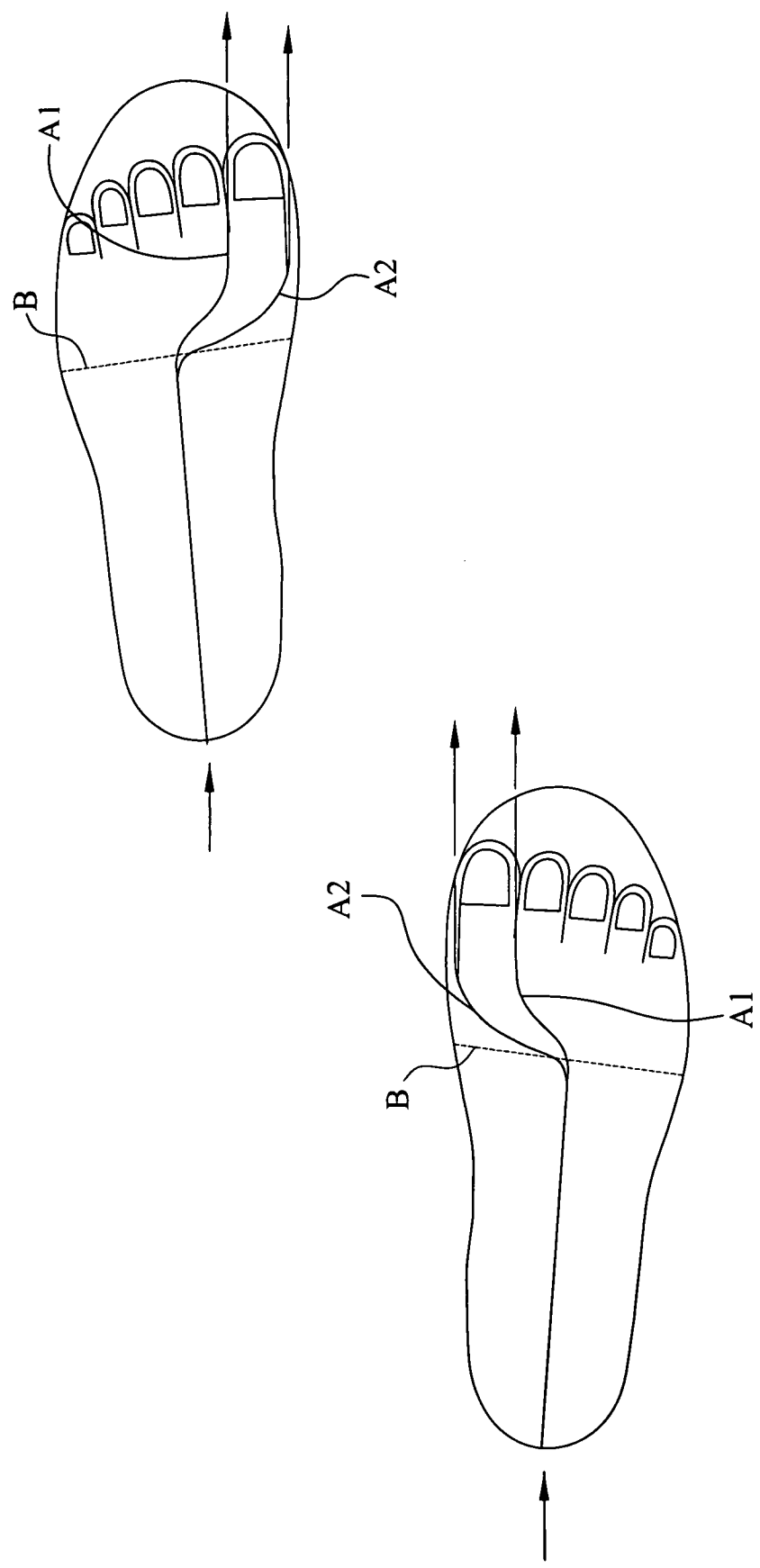


圖1

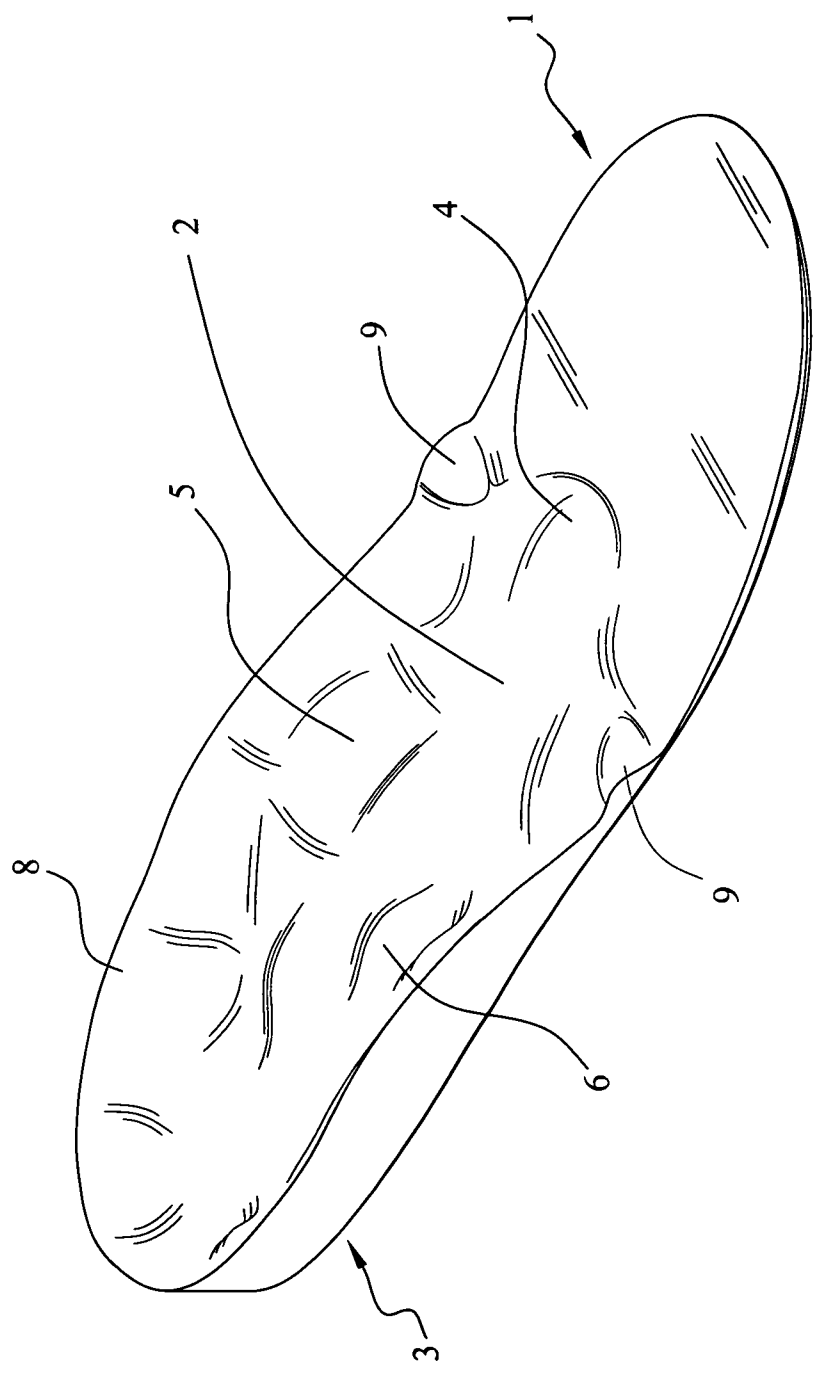


圖2

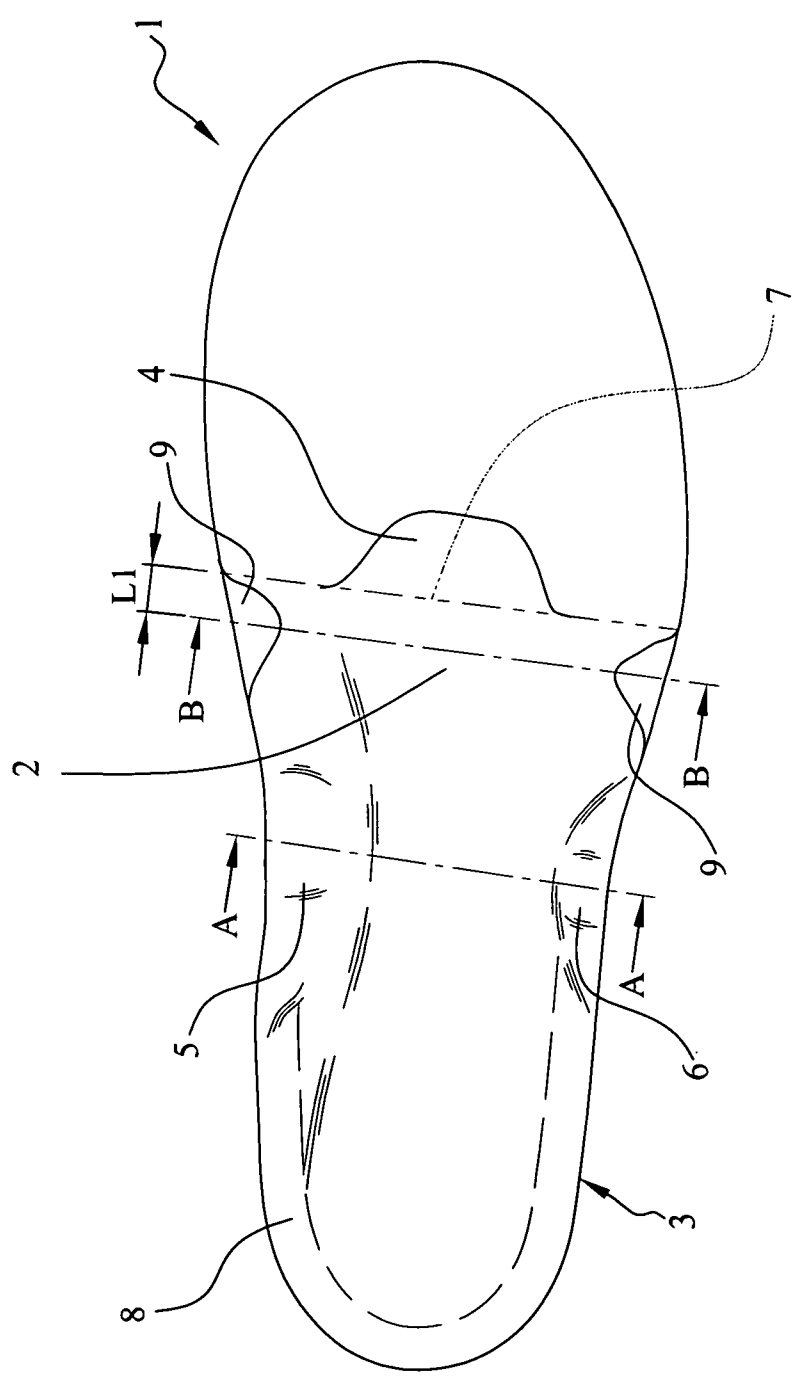


圖3

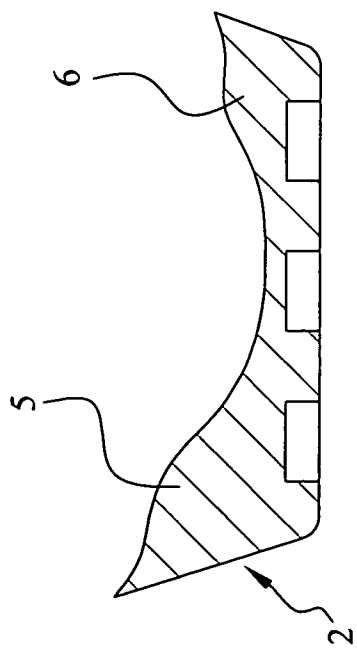


圖4A

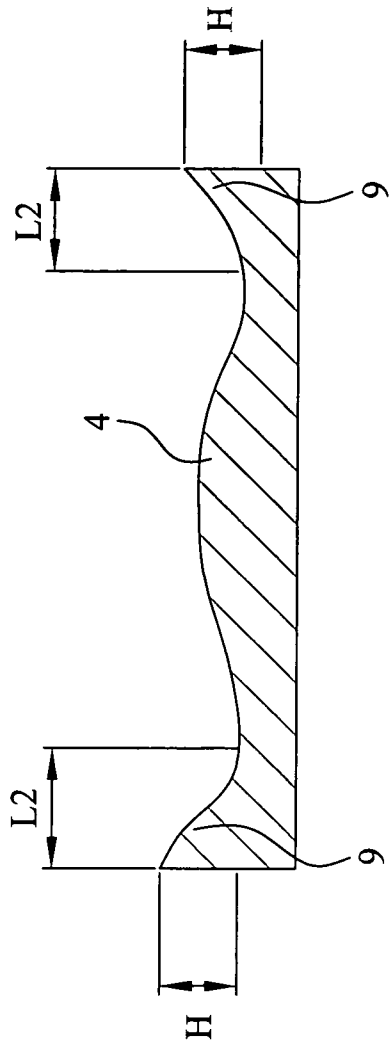
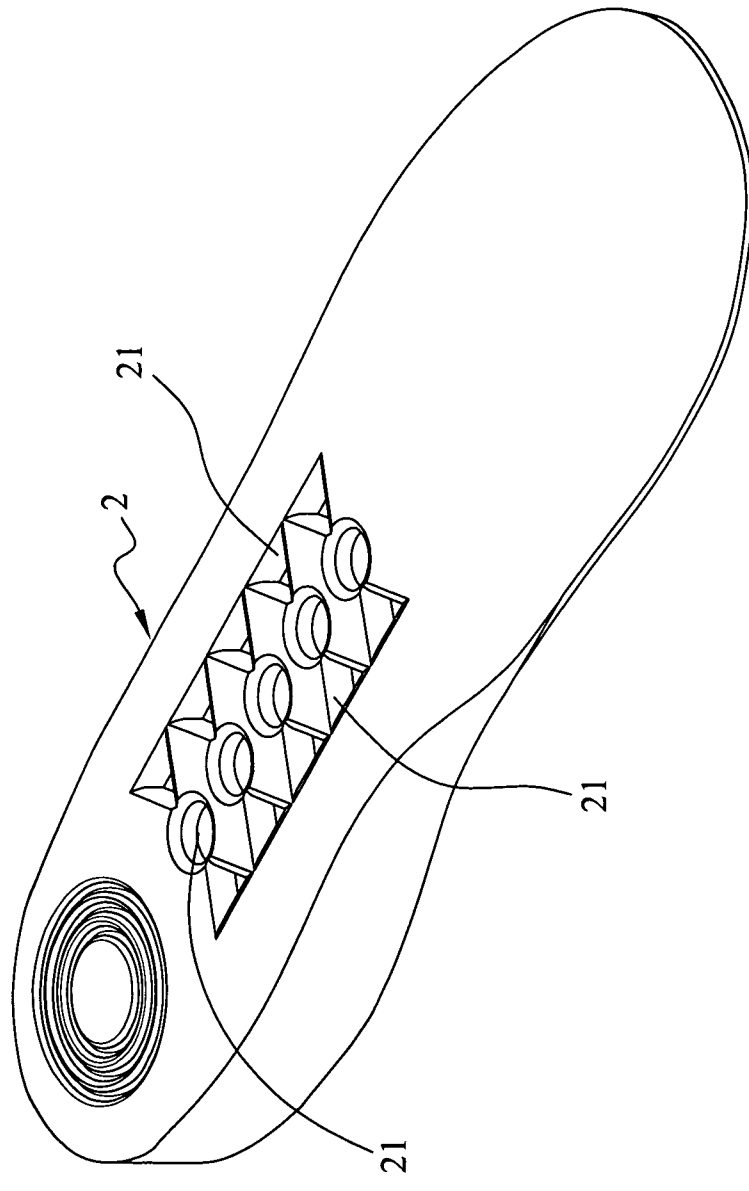


圖4B



第5圖

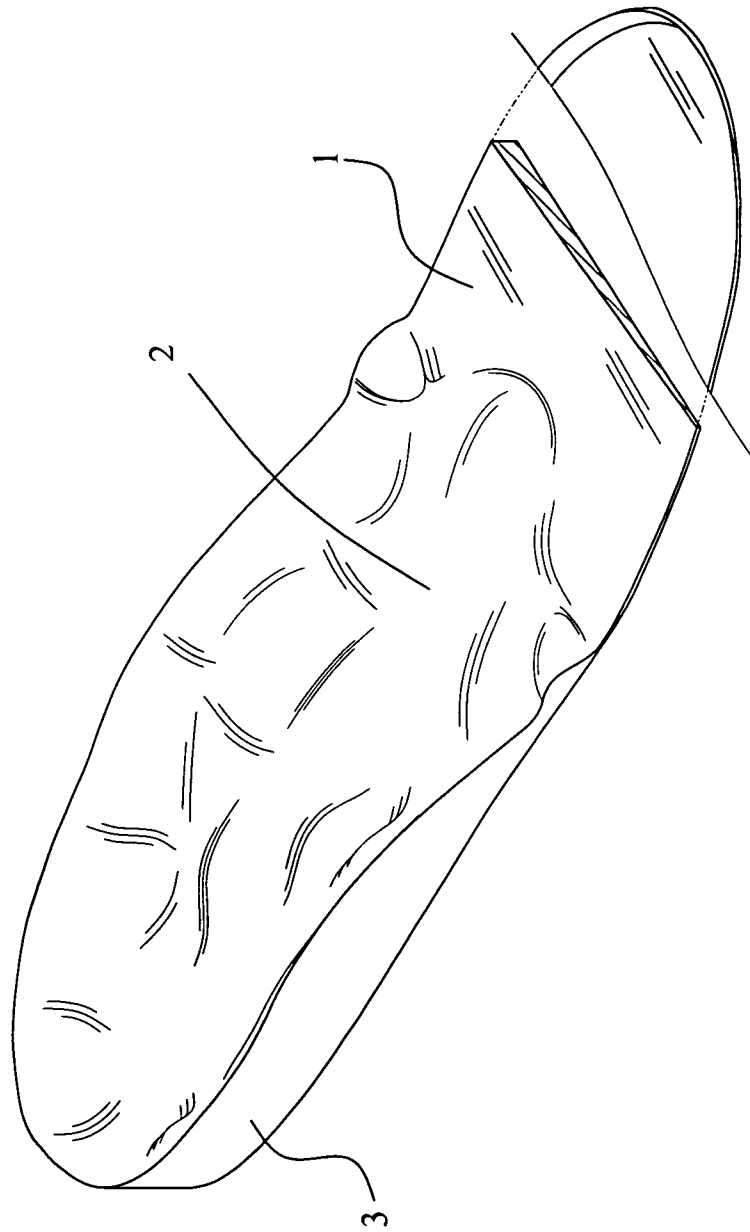


圖6

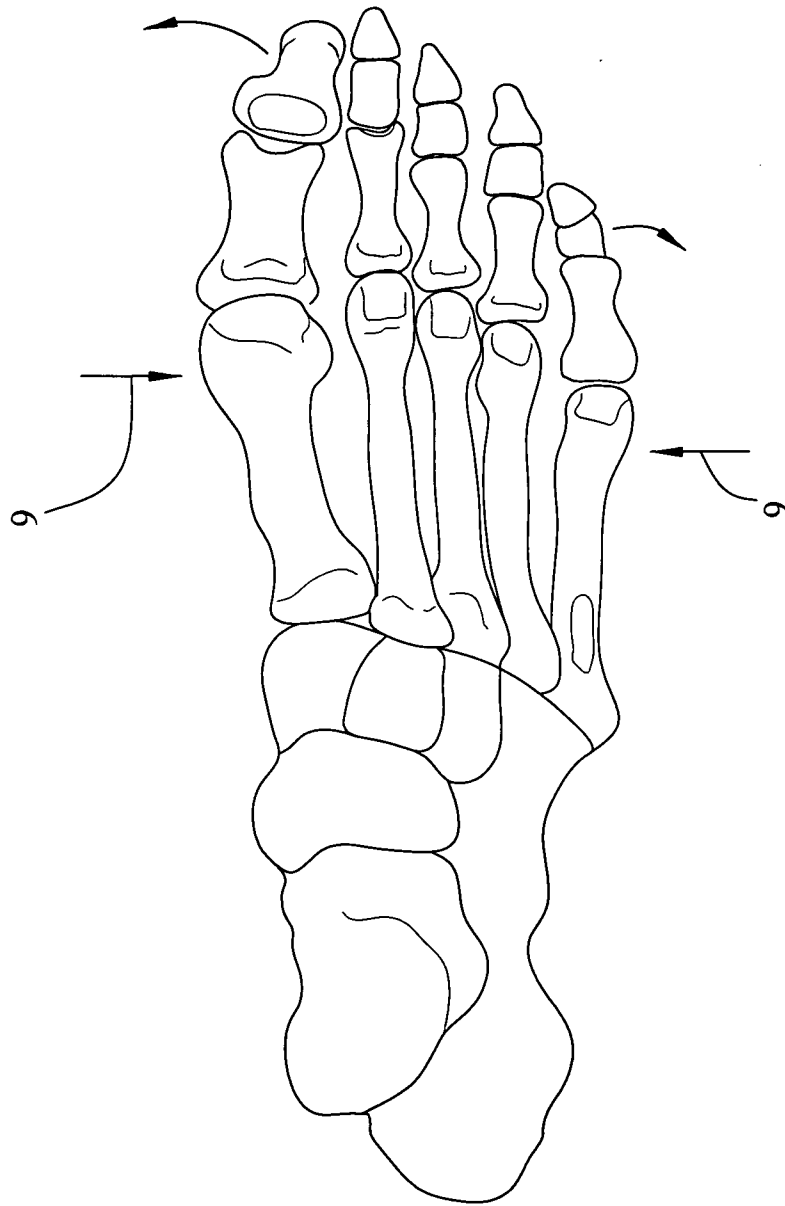


圖 7